科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 27 年 5 月 23 日現在

機関番号: 14401

研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2013~2014

課題番号: 25630283

研究課題名(和文)p/n制御が可能な酸化物系I-III-VI2化合物半導体の物質・機能開拓

研究課題名(英文)Exploring of I-III-VI2 oxide semiconductors and their new functions

研究代表者

小俣 孝久 (Omata, Takahisa)

大阪大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授

研究者番号:80267640

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、酸化物半導体としては類まれな1.45eVの小さなバンドギャップを有するウルツ鉱型 -CuGaO2の結晶構造の精密解析した。また、この結晶が空気中でも300 以下では実際上安定な準安定相であることを明らかにした、GaサイトへのBeおよびTiのドーピングが可能であることを示したが、注入された電子・正孔を活性化するには至らなかった。電子構造の計算と実測から、この結晶はバンド端近傍で強い光吸収を示すことを明らかとし、CdTe、CuInSe2などと最高変換効率を競いうる、酸化物では唯一の物質であることを明らかにした。

研究成果の概要(英文): Crystal structure of -CuGaO2 was refined and its stability was evaluated using TG-DTA and high temperature XRD. As a result, this material is a metastable phase, but practically stable <300 °C even under oxygen atmosphere. Impurity doping was attempted, and possibility of carrier injection by impurity doping was suggested. Based on the first principles density functional calculation, it was shown that -CuGaO2 intensely absorb light around the fundamental absorption edge; therefore, it was shown that this material is a promising oxide semiconductor as a solar cell absorber.

研究分野: 無機材料化学

キーワード: 半導体物性 光物性 ナノ材料 先端機能デバイス

1.研究開始当初の背景

化合物半導体は GaAs, CdSe など III-V, II-VI 化合物に代表される IV 族半導体を元素置換した化合物である。V, VI 族元素は通常 P や S より重い元素であるが、III-V 半導体では GaN など窒化物も含まれる。一方、酸化物の II-VI 半導体は ZnO だけである上、ZnO では p 型化が難しい、バンドギャップ制御に岩塩型化合物を使用するなどのため、酸化物は化合物半導体のマイナーな材料系となっている。 広範囲でバンドギャップを制御でき p/n 制御も容易なダイアモンド関連構造の酸化物が現れれば、酸化物半導体を化合物半導体のメジャーな材料系へと広げられる。

II-VI カルコゲナイド半導体では、II 族元素 を I 族と III 族で置換した I-III-VI2半導体が永 く研究され、CuInSe など実用材料も存在す る。従来、酸化物では I-III-VI2 半導体(I-III-O2 半導体)についての研究が少なかったが、研究 代表者らはウルツ鉱超構造の β-NaFeO₂ 構造 (図 1, 2)に注目し、β-LiGaO₂ (Eg~5.6eV), β-AgGaO₂(2.4eV)と ZnO との混晶化により 2.4~4.0eV でのバンドギャップ制御に成功し た。しかし、いずれも n 型半導体であり、p-n 接合に供しうる酸化物半導体は見出されて いなかった。このような状況の下で、研究代 表者らは p/n 制御が可能な物質を見出すべく 検討を重ね、価電子帯上部に d 軌道が混成す る Cu⁺を含む β-CuGaO₂(Eg~1.6eV)の合成に成 功した。

2.研究の目的

前述した β -CuGaO₂ は発見後間もないことから、その物性の詳細は明らかでない。本研究では以下を行い、 β -CuGaO₂の p/n 制御、電子構造や光学的性質の解明を通じ、 β -CuGaO₂の化合物半導体としてのポテンシャルを明らかにすることを目的とした。

- (1)β-CuGaO₂ の薄膜化、光学的・電気的性 質の解明および p 型/n 型ドーピング
- (2)β-CuGaO₂のエネルギーバンド構造の実験的および理論的解析

3.研究の方法

β-CuGaO₂は、β-NaGaO₂を前駆体としてNa⁺ を Cu⁺に交換する方法で作製した。前駆体 β-NaGaO₂ は Na₂CO₃ と Ga₂O₃ をモル比 1.06:1 でエタノールを用いて湿式混合し、圧粉した ものを 900 で 20h 焼結して得た。β-NaGaO₂ と CuCl をモル比 1:1 で乾式混合し、圧粉体 を真空中 300 で 48h 焼成した。室温まで冷 却したのち、生成した NaCl を水で洗い流し て真空乾燥した。結晶構造の詳細を放射光 XRD の Rietveld 解析により研究した。熱安定 性を DSC および高温 XRD により検討した。 p/n ドーピングについては、前駆体 β-NaGaO₂ の Ga 位置に Be, Ti を固溶した試料を作製し、 そのイオン交換により検討した。薄膜化は β -NaGaO $_2$ をターゲットとしてスパッタリン グ法により作製した前駆体薄膜のイオン交 換により試みた。

電子構造については、XPS スペクトルおよび LDA+U 法による第一原理計算から解析した。

4. 研究成果

(1)β-CuGaO₂の結晶構造と熱安定性

図 1 に Rietveld 解析の結果を、表 1 に最適化により得られた構造データを示す。図 1 より計算値は実測値と妥当な一致を示していることがわかる。 Cu-O、Ga-O 距離および O-Cu-O、O-Ga-O 結合角はそれぞれ 2.03 ~ 2.15 、 1.84 ~ 1.88 、 102.3 ~ 122.4° および 107.0 ~ 111.3° であり、CuO4 および GaO4 四面体の正四面体からの歪はいずれもそれほど大きくないことが明らかとなった。また、酸素を中心とした OCu $_2$ Ga $_2$ 四面体の結合角も 94.0 ~ 117.6° であり、正四面体からそれほど大きな歪は無かった。即ち、 β -CuGaO $_2$ は母構造であるウルツ鉱型からの歪が小さい構造であることが明らかとなった。

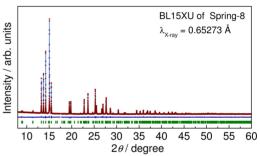


図1 放射光 XRD による β-CuGaO2相の Rietveld 解析結果

表 1 . β-CuGaO₂ の構造パラメータ

Space group	$Pna2_1$ $a_0 = 5.46004(1), b_0 = 6.61013(2), c_0 = 5.27417(1)$				
Lattice parameters (Å)					
Atomic parameters	site	х	у	z	$U(\text{Å}^2)$
Cu	4 <i>a</i>	0.4414(1)	0.1285(4)	0.5046(5)	0.0247(3)
Ga	4a	0.0782(1)	0.1233(3)	0	0.0071(2)
O(1)	4a	0.4071(6)	0.1408(11)	0.9094(6)	0.0065(11)
O(2)	4 <i>a</i>	0.4418(7)	0.6002(10)	0.8488(6)	0.0050(11)

図 2 に Ar 中および空気中で β - $CuGaO_2$ を加熱した際の高温 XRD を示す。Ar 中では 495 で、酸素中では 300 で発熱ピークが観測され、別の相への相変態が示唆された。図 3 に Ar 中および空気中で β - $CuGaO_2$ を加熱した際の高温 XRD を示す。Ar 中では 460 以上でデラフォサイト型構造の α - $CuGaO_2$ 相へ、空気中では 350 以上でスピネル型 $CuGa_2O_4$ と CuO へと相変化し、 β - $CuGaO_2$ が準安定相であることが示唆されたが、室温 \sim 350 の範囲では実際上安定であり、太陽電池やセンサー、LED などへの使用には十分耐えうる材料であることが明らかとなった。

β-Cu GaO_2 の電気伝導度は $1 \times 10^{-6} \Omega^{-1}$ cm $^{-1}$ であった。ゼーベック係数は $400 \mu V K^{-1}$ で符号は正であった。このことから、積極的なドーピ

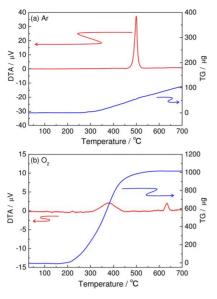
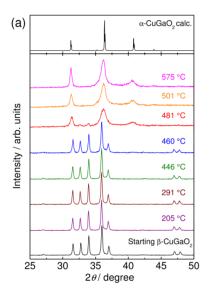


図 2 .β-CuGaO₂ を出発試料とした TG-DTA 曲線 (a)Ar 中,(b)酸素中



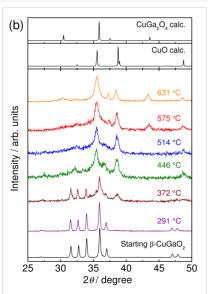


図 3 . β -CuGaO $_2$ を出発試料とした高温 XRD . (a)Ar 中 , (b)空気中

ングをしない状態で、β-CuGaO2はp型半導体

であることが明らかとなった。正孔はおそらく Cu 欠陥により導入されている者と推察された。

図 4 に Ga サイトに Be あるいは Ti をドーピングした β - $CuGaO_2$ の格子定数変化を示す。 Be ドープした試料では 3%まで、Ti ドープした試料では 5%まで β - $NaFeO_2$ 構造の単相が得られており、いずれもこの組成まで不純物ドーピングが可能であることを示している。 しかしながら、伝導度の大きな増大は観測され

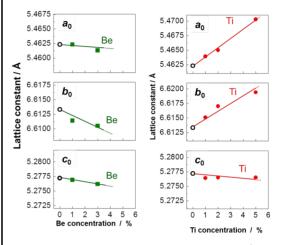


図4. Ga サイトに Be あるいは Ti をドープした β-CuGaO₂ における格子定数変化

ず、注入されたキャリアは何らかの欠陥の生成により補償されているものと推察される。 今後、キャリアの活性化の検討が必要である。 図5にβ-NaGaO2薄膜をCuCl蒸気中でイオン交換して作製したβ-CuGaO2薄膜の写真および光吸収スペクトルを示す。比較的均一な薄膜が得られている様子、かつ、吸収端が1.46eV でありバルクのそれと一致する様子

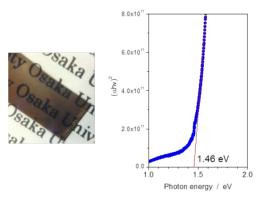


図 5. β -CuGaO $_2$ 薄膜の写真(左)と光吸収スペクトル(右)

が観測される。今後、成膜条件等を詳細に検討することで、より良質な薄膜が得られることが期待される。

図 6 に U=6eV で LDA + U 法により計算した XPS と、 $AgL\alpha$ 線を励起光源とした実測 XPS の比較を示す。これらは非常によく一致しており、U=6eV とすることで真のバンド構造を再現することが明らかとなった。図 7 に U=6eV で計算した β - $CuGaO_2$ のエネルギーバ

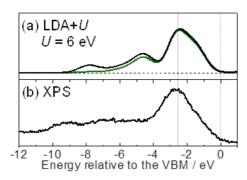
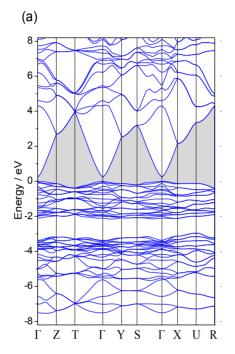


図 6.(a) LDA+U(U=6eV)でシミュレーションした β -CuGaO $_2$ の XPS $\mathcal{E}(b)$ AgL α 線励起で測定した実測 XPS .計算 XPS の緑線は Cu3d の成分を示す.



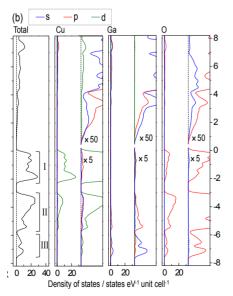


図 7 . (a) LDA+U(U=6eV)で計算した β -CuGaO $_2$ の(a)バンド構造と(b)PDOS .

ンド構造と PDOS を示す。価電子帯の上部は Cu3d の強い寄与により構成され、実験的に p 型伝導性を示すことをよく説明できる。しかしながらその分散はそれほど大きくなく、あまり大きな移動度は期待できない。一方、伝導帯の底部はCu4s およびGa4s がよく混成した状態からなる。そのバンド分散は大きく、電子が注入できれば高い移動度となることが期待できる。表 2 に放物線近似により求めた電子および正孔の有効質量を示す。

表 2. β-CuGaO₂の正孔・電子の有効質量

Ho	le	Electron		
Direction	m_h */ m_0	Direction	$\mathrm{m_e}^{\star}/\mathrm{m_0}$	
$\Gamma \rightarrow X$	5.1	$\Gamma \rightarrow X$	0.21	
$\Gamma \rightarrow Y$	1.7	$\Gamma \rightarrow Y$	0.21	
$\Gamma \rightarrow Z$	4.9	$\Gamma \rightarrow Z$	0.21	
$\Gamma \!\! o \!\! \! R$	2.7	$\Gamma \rightarrow \mathbb{R}$	0.21	

図 8 には U=6eV のバンド構造からシュミレーションした光吸収スペクトルを示す。バンド端近傍で吸収係数は $10^5 \mathrm{cm}^{-1}$ に達し、太陽電池材料として知られる CdTe や CuInSe2と同程度の強い吸収を示すことが明らかとなった。直接遷移型半導体、強い光吸収、n型 ZnO 半導体との優れた格子整合性を総合すると、 β -CuGaO2 は酸化物では唯一の CdTe、CuInSe2 などと最高変換効率を競いうる、優れた太陽電池材料であることが明らかとなった。

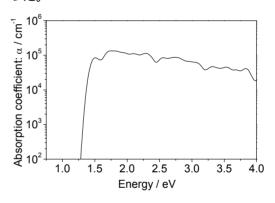


図 8 . LDA+U(U=6eV)でシミュレーションした β-CuGaO₂ の光吸収スペクトル

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計7件)

"Wurtzite-derived ternary I-III- O_2 semiconductors", T. Omata, H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, *Sci. Technol. Adv. Mater.* **16**, 024902 (2015). (查読有)

DOI: 10.1088/1468-6996/16/2/024902

"Structural and thermal properties of a ternary narrow gap oxide semiconductor; wurtzite-derived β-CuGaO₂", H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, M. Tanaka, Y. Katsuya, O. Sakata, S. Miyoshi, S. Yamaguchi, <u>T. Omata</u>, *Inorg. Chem.* **54**, 1698–1704 (2015). (查読 有)

DOI: 10.1021/ic502659e

"Structure of β-AgGaO₂; ternary I-III-VI₂ oxide semiconductor with a wurtzite-derived structure", H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, M. Tanaka, Y. Katsuya, O. Sakata and <u>T. Omata</u>, *J. Solid State Chem.* 222, 66–70(2015). (査読有)

DOI: 10.1016/j.jssc.2014.11.012

"Ternary and Quaternary Wurtzite-type Oxide Semiconductors; New Materials and Their Properties", T. Omata, Proceedings of SPIE, Vol. 9364, 93641L(2015). (查読無) DOI: 10.1117/12.2175570

"Wurtzite CuGaO₂: A direct and narrow band gap oxide semiconductor applicable to solar cell absorber", T. Omata, H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, H. Yanagi and N. Ohashi, *J. Am. Chem. Soc.* 136, 3378-3381(2014). (查読有)

DOI: 10.1021/ja501614n

"Fabrication of β-AgGaO₂ thin film by rf-magnetron sputtering", I. Suzuki, H. Nagatani, Y. Arima, M. Kita and <u>T. Omata</u>, *Thin Solid Films*, 559, 112-115(2014). (查読有)

DOI: 10.1016/j.tsf.2013.10.099

"Pseudo-Binary Alloying System of ZnO-AgGaO₂ Reducing the Energy Band Gap of Zinc Oxide", I. Suzuki, H. Nagatani, Y. Arima, M. Kita and <u>T. Omata</u>, *Appl. Phys. Lett.* **103**, 222107 (2013). (查読有)

DOI: 10.1063/1.4836435

[学会発表](計23件)

"New Pseudo-Binary Alloy System of $x(AgGaO_2)_{1/2}$ -(1-x)ZnO for Band Gap Narrowing of ZnO ", I. Suzuki, Y. Arima, M. Kita, T. Omata, 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit, California, USA, (April 2013).

"Band Gap Narrowing of ZnO by Alloying with -AgGaO₂", I. Suzuki, Y. Arima, M. Kita, T. Omata, 8th International Symposium on Transparent Oxide and Related Materials for Electronics and Optics (TOEO8), Tokyo, (May 2013).

"Band Gap Engineering of ZnO by Alloying with β -AgGaO₂", I. Suzuki, H. Nagatani, Y. Arima, M. Kita, T. Omata, The 2nd International Seminar: International Workshop on Green Energy Conversion, Koumi, Nagano, Japan (September 2013).

「新規の薄膜太陽電池用酸化物半導体; -CuGaO₂」,長谷拓、鈴木一誓、喜多 正雄、柳博、大橋直樹、小俣孝久,資源・ 素材学会関西支部 第 10 回若手研究 者・学生のための研究発表会,京都、2013 年 12 月

「ウルツ鉱型 - $CuGaO_2$ 、 - $AgGaO_2$ の 第一原理計算」、鈴木一誓、長谷拓、喜

多正雄、井口雄喜、佐藤千友紀、柳博、 大橋直樹、小俣孝久,第9回日本セラミ ックス協会関西支部学術講演会、なかも ず(2014年7月25日)

「直接遷移型ナローギャップ半導体;ウルツ鉱型 -CuGaO₂」,長谷拓、鈴木一誓、喜多正雄、柳博、田中雅彦、勝矢良雄、坂田修身、大橋直樹、小俣孝久,第9回日本セラミックス協会関西支部学術講演会、なかもず(2014 年 7 月 25 日)

「 $CuAlO_2$ との混晶化によるウルツ鉱型 $CuGaO_2$ のバンドギャップエンジニアリング」, 水野裕貴、長谷拓、鈴木一誓、喜多正雄、小俣孝久,第9回日本セラミックス協会関西支部学術講演会、なかもず(2014 年 7 月 25 日)

「ウルツ鉱型 -CuGaO₂、 -AgGaO₂の 第一原理計算」, 鈴木一誓、長谷拓、喜 多正雄、井口雄喜、佐藤千友紀、柳博、 大橋直樹、小俣孝久,第75回 応用物理 学会秋季学術講演会、札幌(2014年9月 19日)

「CuAlO₂ との混晶化よる -CuGaO₂ の バンドギャップエンジニアリング」, 水 野 裕貴、長谷 拓、鈴木 一誓、小俣 孝 久,資源・素材学会関西支部 第 11 回 若手研究者・学生のための研究発表会 (京都、2014 年 12 月 12 日)

"First Principle Calculations of Electronic Band Structures of Wurtzite -CuGaO₂ and -AgGaO₂", I. Suzuki, H. Nagatani, M. Kita, Y. Iguchi, C. Sato, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata,

" A New Direct and Narrow Band Gap Oxide Semiconductor; Wurtzite CuGaO₂", H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata, The 8th International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC8) (Yokohama, June 25-27, 2014).

"FIRST PRINCIPLE CALCULATIONS OF **ELECTRONIC** BAND STRUCTURES OF WURTXITE β-CuGaO₂ and β-AgGaO₂", I. Suzuki, H. Nagatani, M. Kita, Y. Iguchi, C. Sato, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata, The 3rd International Seminar: International Workshop on Green Energy Conversion (Hokuto, Yamanashi, Japan, August, 2014). "A NEW DIRECT AND NARROW BAND **GAP OXIDE** SEMICONDUCTOR; WURTZITE CuGaO₂", H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, H. Yanagi, N. Ohashi, T. Omata, The 3rd International Seminar: International Workshop on Green Energy Conversion (Hokuto, Yamanashi, Japan, August, 2014).

"BAND GAP ENGINEERING OF WURTZITE-DERIVED CuGaO2 WITH

CuAlO₂.", Y. Mizuno, H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, T. Omata, The 3rd International Seminar: International Workshop on Green Energy Conversion (Hokuto, Yamanashi, Japan, August, 2014). "First Principle Calculation of Electronic Band Structure of Wurtzite β-CuGaO₂ and β-AgGaO₂", I. Suzuki, H. Nagatani, M. Kita, Y. Iguchi, C. Sato, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata, 8th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials, Niagara Falls, Ontario, Canada, (September 7-11, 2014).

"Band Gap Narrowing of ZnO by Alloying with -AgGaO₂", I. Suzuki, Y. Arima, M. Kita, T. Omata, 8th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials, Niagara Falls, Ontario, Canada, (September 7-11, 2014).

" A New Ternary Oxide Semiconductor; Wurtzite CuGaO₂", H. Nagatani, I. Suzuki, M. Kita, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata, 8th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials, Niagara Falls, Ontario, Canada, (September 7-11, 2014). "Wurtzite I-III-O₂ Ternary Oxide Semiconductors: New Mtaerials and Application", T. Omata, 8th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials, Niagara Falls, Ontario, Canada, (September 7-11, 2014).

"Novel Ternary Wurtzite-type Semiconductor, -CuGaO₂", I. Suzuki, H. Nagatani, M. Kita, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata, 2014 MRS Fall Meeting & Exhibit, Boston, USA, (Dec. 1-5, 2014). "First Principle Calculations of Wurtzite -CuGaO₂ and -AgGaO₂", I. Suzuki, H. Nagatani, M. Kita, Y. Iguchi, C. Sato, H. Yanagi, N. Ohashi and T. Omata, 2014 MRS Fall Meeting & Exhibit, Boston, USA (Dec. 1-5, 2014).

- 21 「新規酸化物半導体:ウルツ鉱型-CuGaO₂」, 鈴木一誓、長谷拓、喜多正雄、井口雄喜、佐藤千友紀、柳博、大橋直樹、小俣孝久, 日本セラミックス 協会2015 年 年会、岡山(2015 年 3 月 20 日)
- 22 「ウルツ鉱型 -CuGaO₂ の第一原理計算」, 鈴木一誓、長谷拓、喜多正雄、井口雄喜、佐藤千友紀、柳博、大橋直樹、小俣孝久, 日本セラミックス 協会2015 年 年会、岡山(2015 年 3 月 20 日)
- 23 "Ternary and Quaternary Wurtzite-type Oxide Semiconductors; New Materials and Their Properties", T. Omata, SPIE: Photonics WEST2015; Oxide based Materials and Devices VI, San Fransisco, USA (Feb. 7-12, 2015)

[産業財産権]

○出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 該当なし

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者 小俣孝久(OMATA, Takahisa) 大阪大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:
- (2)研究分担者 なし
- (3)連携研究者 大橋直樹 (OHASHI , Naoki) 物質・材料研究機構・部門長 研究者番号: 60251617

柳 博 (YANAGI, Hiroshi) 山梨大学・医学工学総合研究部・准教授 研究者番号: 30361794